

拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願2003-502829
起案日	平成19年 4月19日
特許庁審査官	蔵野 雅昭 3868 5D00
特許出願人代理人	林 恒徳(外 1名) 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
3. この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第36条第4項に規定する要件を満たしていない。
4. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
5. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

[理由1]

請求項: 1-4、12-14

引用文献: 1

備考:

引用文献1には、超解像度再生を行う光磁気ディスク装置であって、光ピックアップの光軸よりずれた位置に磁界発生源を設けることで、ディスクに印加される磁界の強さを、光軸上と磁界発生源の直下とで異なるものとした発明が記載されている。(段落0008、段落0010、段落0014、図1等参照)

請求項1、12に係る発明と引用文献1に記載された発明を比較すると、両者の発明特定事項に差異はない。

[理由2]

請求項: 1-19

引用文献: 1

備考:

請求項1-19に係る発明においては「バイアス磁界発生手段」を設けたことが記載されている。しかし、下記[理由4]1、3で説明するように「バイアス磁界発生手段」を設ける技術的意義が不明である。よって、引用文献1において、再生とは関わりのないバイアス磁界を設けて請求項1-19に係る発明とすることは、適宜なし得ることである。

[理由3、4]

1. 下記の点が不明であるから本願発明の課題が不明であり、本願発明の技術的意義も不明である。

(1) 本願の発明の詳細な説明においては、従来技術として磁気超解像技術を利用したD-RAD方式を挙げ、その説明を図10に基づいて行っている。しかし、下記の点が不明であるから、本願の想定する従来技術が一体何であるのか不明である。

(a) 一般的にD-RAD方式においては、再生前に初期化磁界を印加し再生層の磁化の向きを揃え、再生時に再生磁界を印加することで再生するものである。しかし、発明の詳細な説明、及び、図10においては、「再生磁場 H_r 」のみが印加されているだけであるから、これはD-RAD方式ではない。

(b) 図10においては、再生磁場を上向きに印加しているにも関わらず、「フロントマスク」部の磁化の向きが下向きで揃っている。なぜこのようなことが起こるのか不明である。

(c) 上記(a)(b)から、発明の詳細な説明で従来技術として説明されている再生方法は、一体どのような再生原理を用いたものであるのか不明である。

(2) あくまで従来技術としてD-RAD方式を想定していると仮定しても、初

期化磁界と再生磁界の二つの磁界発生手段が必要になるはずである。しかし、本願の発明の詳細な説明に記載されている実施例は、一つの磁界発生手段の中心を照射スポットの中心からずらすことによって最適化するものであるから、従来技術を改善しているとは考えられない。

〔理由 4〕

1. 請求項 1 において、下記の点が明確でない。

(1) 「バイアス磁界発生部」が再生時にバイアス磁界を印加することが明確になっていないから、そのような「バイアス磁界発生部」を設ける技術的意義が不明である。

(2) バイアス磁界のピーク位置が光ビームスポットの中心に対して所定の方向にずれていることが記載されているが、「所定の方向」という表現ではどの方向にずれているのか明確でない。(本願の発明の詳細な説明(図4等)を参照すれば、トラック方向において、バイアス磁界のピークが光ビームスポットの中心に対して、ディスクの進行方向手前側になるようにした点に特徴があるから、それが明確となる記載にすべきである。)

2. 請求項 2 において、バイアス磁界のピーク位置が光ビーム照射スポットの中心に対して略トラック方向前方又は後方にずれていると記載されている。しかし、「略トラック方向前方又は後方」という表現ではどの方向にずれているのか明確でない。(「前方又は後方」という表現は、トラック方向にずれていること以外にずれ方向を何ら特定するものではない。本願の発明の詳細な説明(図4等)を参照すれば、トラック方向において、バイアス磁界のピークが光ビームスポットの中心に対して、ディスクの進行方向手前側になるようにした点に特徴があるから、それが明確となる記載にすべきである。)

3. 請求項 4 において、ヨークの幅方向における中心が光ビーム照射スポットの中心に対して幅方向にずれていると記載されている。しかし、「幅方向」という表現ではどの方向にずれているのか明確でない。(本願の発明の詳細な説明(図4等)を参照すれば、トラック方向において、バイアス磁界のピークが光ビームスポットの中心に対して、ディスクの進行方向手前側になるようにした点に特徴があるから、それが明確となる記載にすべきである。)

4. 請求項 1 2 において、下記の点が明確でない。

(1) 「バイアス磁界発生部」が再生時にバイアス磁界を印加することが明確になっていないから、そのような「バイアス磁界発生部」を設ける技術的意義が不明である。

(2) バイアス磁界のピーク位置が対物レンズの光軸に対してカートリッジホル

ダの幅方向にシフトしていることが記載されている。しかし、「カートリッジホルダの幅方向」という表現では、どの方向にずれているのか明確でない。（〔理由4〕1～3を参照。）

5. 請求項14において、ヨークの幅方向における中心が光ビーム照射スポットの中心に対して幅方向にずれていると記載されている。しかし、「幅方向」という表現ではどの方向にずれているのか明確でない。（〔理由4〕1～3を参照。）

〔理由4、5〕

1. 請求項10、11においては、下記の点が明確でなく、また、発明の詳細な説明に開示された内容を超えるものとなっている。

（1）「バイアス磁界発生部」が再生時にバイアス磁界を印加することが明確になっていないから、そのような「バイアス磁界発生部」を設ける技術的意義が不明である。

（2）「フロントマスク用磁界」と「リアマスク用磁界」の二つの磁界を印加する装置が記載されている。しかし、本願の発明の詳細な説明には、そのような二つの磁界を印加する装置は記載も示唆もされていない。（本願の発明の詳細な説明には、磁界発生手段を一つだけ有するものしか開示されていない。）

引用文献等一覧

1. 特開平5-303790号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した技術分野

G11B11/10 ～ G11B11/105
G11B5/02

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

連絡先	特許審査第四部情報記録	渡部	博樹
電話	03-3581-1101	内線	3549
FAX	03-3580-6906		